トピックス

# 磁壁移動検出方式による光磁気ディスクの高密度化

Realization of a High-Density Magneto-Optical Disk through the Use of Domain Wall Displacement Detection

## 白鳥 力 キャノン(株)製品技術研究センター

T. Shiratori, Products Technology Research Center, Canon Inc.

The domain wall displacement detection (DWDD) method is a new magneto-optical readout method that utilizes the domain wall displacement caused by the temperature gradient. It allows high-density signal patterns to be read out irrespective of the resolution limit of the readout optical system.

This paper reviews the basic mechanism and the dynamic properties of this method. A clear readout waveform was obtained and a flat signal amplitude dependence on the mark length was maintained even for a domain length of  $0.1 \,\mu$ m.

The ghost signal, which was the main problem within this method, was suppressed by modifying the recording medium. As a result, a wide jitter margin could be obtained for a random signal with a linear density of  $0.1 \,\mu$ m/bit.

An approach to reducing the track pitch in this method is also described.

**Key words:** magneto-optical recording, domain wall, wall energy, domain wall displacement, exchange-coupling, nucleation, interface wall, resolution

## 1. はじめに

近年,光ディスクメモリの高密度化技術は日進月歩の進展を呈しており,DVDサイズのディスク片面で15GB程度の記録容量実現はもはや当たり前のことのように言われるようになってきている.これは青色半導体レーザーの実用化が視野に入ってきたことによる影響が大きい.

しかし,動画像のデジタル化ならびに圧縮符号化技術の 急速な進展に伴う動画情報の増大を考慮すると,光ディス クメモリに対する高密度化への要求は今後ますます加速し ていくと考えられる.光学系の高分解能化技術の進展を座 して待っていたのでは,この要求に十分に対応していくこ とは困難であろう.

記録層として磁性膜を用いる光磁気ディスクメモリにおいては、光学系の分解能によって制約される記録密度の限 界を、磁性膜の多様な物性を利用して克服するさまざまな 方法が、これまでに提案されてきている<sup>1)~3)</sup>.

磁壁移動検出方式 (DWDD: Domain Wall Displace-

ment Detection)は、温度勾配による磁壁移動現象という 磁性膜のユニークな性質を利用した全く新しい再生方式で ある<sup>4)</sup>.この方式においては、一定の閾値温度の等温線が記 録パターンを弁別していくので、線記録密度方向には原理 的に再生上の分解能の限界がなくなり、光学系の分解能に よる束縛から完全に解放される.

磁壁移動検出方式によれば,現行の波長 680 nm あるい は 780 nm 程度の光学系を用いても,DVD サイズ片面 15 GB 程度の記録容量を実現できる. もちろん光学系を高分 解能化してトラック密度方向にも高密度化すればさらなる 大容量化が可能であり,原理的な可能性を述べればきりが なくなる. 今後の急速な高密度化・大容量化へのニーズに 対しても十分に対応していくことが可能と考えられる.

本稿においては,磁壁移動検出方式の動作原理を解説 し,基本動作確認結果,実用化する上での問題点とその解 決策などについて概要を述べる.

#### 2. 磁壁移動検出方式の動作原理

Fig. 1 は磁壁移動検出方式の動作原理を示している. Fig. 1(a) に示したように、記録媒体は、小さな磁壁抗磁力 を呈する移動層と、相対的に低いキュリー温度  $T_s$ を有す るスィッチング層と、大きな磁壁抗磁力を呈するメモリ層 からなる交換結合 3 層膜で構成される.

記録膜面上を再生用のレーザービームを利用して局所的 に加熱すると, Fig. 1(b) に示したような温度分布が形成さ れ, これに伴って, 磁壁エネルギー密度の分布が Fig. 1(c) に示したように形成される.磁壁エネルギー密度は一般的 に温度が上昇するほど低下するので, ピーク温度の位置で 磁壁エネルギー密度が最も低くなるような分布になる.

この結果,磁壁をエネルギー密度の低い高温側へ移動さ せようとする磁壁駆動力が Fig. 1(d) に示したように発生 する<sup>5)</sup>.

媒体温度がスィッチング層のキュリー温度 T<sub>s</sub>よりも低い場所では、各磁性層は互いに交換結合しているため、前述の温度勾配による磁壁駆動力が作用しても、メモリ層の大きな磁壁抗磁力に阻止されて磁壁移動は起こらない.ところが、媒体温度が T<sub>s</sub>よりも高い場所では移動層とメモ

日本応用磁気学会誌 Vol. 23, No. 2, 1999



Fig. 1 DWDD mechanism.

リ層との間の交換結合が切断されるため、磁壁抗磁力の小 さな移動層中の磁壁は、温度勾配による磁壁駆動力で磁壁 移動可能になる.このため、媒体の走査に伴って、磁壁が 温度 *T*<sub>s</sub>の位置を越えて結合切断領域に侵入した瞬間に、 移動層中の磁壁の高温側への磁壁移動が起こる.

記録膜中に信号に対応した間隔で形成されている磁壁 が、媒体の走査に伴って温度 T<sub>s</sub>の位置を通過するたびに、 移動層内で磁壁移動が発生する.媒体を一定速度で走査す ると、記録されている磁壁の空間的間隔に対応した時間間 隔で、この磁壁移動が発生することになる.したがって、 磁壁移動の発生を検知することにより記録信号を再生する ことができる.磁壁移動の発生は、再生用のレーザービー ムにより、磁壁移動領域の磁化反転に伴う偏光面の変化と して、従来の光磁気光学系で検知することができる.

信号振幅は、磁壁移動距離で決まり、記録されている磁 壁間の距離すなわち磁区長には依存しない.また、再生ス ポットではなく、温度 T<sub>s</sub>の等温線が記録パターンを弁別 していくことになるので、光学系の分解能とは無関係に信 号を再生することができるのである.

以上が磁壁移動検出方式の動作原理である.ただし,実際に信号を再生するためには,以下の二つの問題点について対策を取っておく必要がある.

第一の問題点は、上記のような加熱領域の前方からの磁 壁移動のほかに、Fig. 1(a) 中に破線矢印で示されているよ うに、加熱領域後方からも磁壁移動が発生し、これが再生 用のレーザービームで検出されてしまうということであ る. この問題については、後で述べるように、再生磁界の 印加<sup>6)</sup>や記録膜の工夫<sup>7)</sup>によって解決することができる.



Fig. 3 Unclosed domain walls.

annealed region

domain

第二の問題点は,通常の磁壁は磁区の周囲に閉じた状態 で形成されており,磁区の前端と後端とにそれぞれ独立し た磁壁が存在しているものではないということである.

磁壁が閉じている状態で前端部分の磁壁が温度 T<sub>s</sub>以上 の結合切断領域に侵入して,エネルギー密度の低い高温側 に移動したとすると,Fig.2(a)のように側部に新たな磁壁 が生成されることになり,逆に余計なエネルギーを蓄えて しまうことになる.したがって,実際には例えば Fig.2(b) のように,全体としてのエネルギーが最小になるような適 当な形状に磁壁が変形することになる.これでは良好な再 生信号が得られない.

この問題に対して,生産性やランド/グルーブ記録への 適用を考慮した対応策については後述するが,以下の実験 では,グルーブ部の磁性膜を高出力のレーザービームでア ニール処理して,磁壁が形成されないような状態に変質さ せて対処している.このように処理した媒体のランド上に 幅いっぱいに磁区を記録すると,Fig.3に示したように, 磁区の前端と後端とに独立した磁壁を形成することができ る.実際には,アニール処理した部分は面内磁化膜になっ ていると考えられ,ランドの両側に面内から垂直にスピン 配向が遷移する磁壁が形成されているとも考えられる.し かしその場合でも、このランドの両側の磁壁がランド上の 磁壁の移動に伴って生成・消滅することはないので、エネ ルギー的には側部に磁壁が存在しない場合と等価である.

#### 3. 実験結果

実験に用いた記録媒体の代表的な膜構成を Fig. 4 に示 す. 基板としては,板厚 1.2 mm,トラックピッチ 1.1  $\mu$ m の標準的なポリカーボネイト基板を用いている.メモリ層 のキュリー温度は 290℃,スィッチング層のキュリー温度 は 160℃,移動層のキュリー温度は 250℃ 程度である.各 磁性層の組成は,再生温度となるスィッチング層のキュ リー温度近傍の温度範囲において飽和磁化が極力小さくな るように,鉄族元素と希土類元素との組成比を調整してあ る.これにより,再生時の磁壁の挙動に及ぼす浮遊磁界の 影響が抑制され,温度勾配による磁壁移動動作が安定化す る.

#### 3.1 基本動作確認結果

この光磁気ディスクの動特性を,波長 680 nm, NA 0.55 の光学系を有する通常の光磁気ディスク評価装置により確 認した.記録は DC レーザー照射磁界変調方式で行った. 磁気ヘッドの変調周波数の制約上,ディスク線速度は 1.5 m/s とした.測定に先立って,グルーブ上に 10 mW 程度 のレーザーを照射してアニール処理した.

磁区長  $0.3 \mu m$  の孤立磁区および連続磁区パターンを記録して、再生パワー 1.6 m W で再生したときの再生波形を、それぞれ Fig. 5(a) および (b) に示す.

適当な強度の再生パワーを照射すると、再生スポット下 に T<sub>s</sub>以上の温度に加熱された領域が形成され、閾値温度 T<sub>s</sub>の等温線上からのピーク温度部に向けて磁壁移動が起 こる.この磁壁移動を検出して、明らかに通常の再生波形 とは異なる急峻な信号レベルの変化が起こっているのが Fig.5の波形からわかる.

Fig. 5(a) の波形の(1) で示した信号レベルの急峻な変化 は、磁区前端部の磁壁が結合切断領域に侵入した瞬間に ピーク温度部に向けて磁壁移動したのを検出したものであ り、(2) は、磁区後端部の磁壁が結合切断領域に侵入した瞬 間に磁壁移動したのを検出したものである。

これに対して,(3)は、メモリ層中の磁区前端部が結合切 断領域後方の再結合領域に侵入したときに移動層に再転写 されて形成された磁壁が再生スポット後方から磁壁移動し たのを検出したものであり,(4)は、磁区後端部が再結合領 域に侵入したときに形成された磁壁が再生スポット後方か ら磁壁移動したのを検出したものである。

再生スポットが媒体に対して相対的に移動しているの で、磁壁移動の終着点となる温度分布のピークは、再生ス ポットの中心より若干後方に偏った位置に形成されてい る. このため前方からの磁壁移動は、ガウシアンの強度分 布をもつ再生スポットの中心付近で検出されるのに対し、

UV resin overcoat		
Protective Layer	SiN	50 nm
Memory Layer	TbFeCoCr	80 nm
Switching Layer	TbFeCr	10 nm
Displacement Layer	GdFeCoCr	30 nm
Enhance Layer	SiN	90 nm
Polycarbonate substrate		1.2 mm

Fig. 4 Layer structure of the medium.



Fig. 5 Readout waveforms for (a) isolated and (b) continuous patterns with a domain length of  $0.3 \,\mu\text{m}$ .



Fig. 6 Readout waveforms for (a) isolated and (b) continuous patterns with a domain length of  $0.1 \,\mu\text{m}$ .

後方からの磁壁移動は再生スポットの中心から外れた部分 で検出される.この結果,(1)および(2)で示した信号レベ ルの変化量の方が(3)および(4)で示した信号レベルの変 化量よりも大きくなっている.

このように、前方からの磁壁移動による信号に、後方からの磁壁移動による信号がゴースト信号として重畳される ため、連続信号を再生すると、Fig.5(b)のように4値の信 号レベルを有する波形が現れる.このような重畳が生じる と実効的な信号振幅が両者の差になってしまい、信号再生 上問題である.しかし、以下に述べるように磁区長が短い 場合にはゴースト信号が出なくなる.

Fig. 6(a) および (b) は、磁区長  $0.1 \, \mu m$  の孤立磁区およ び連続磁区パターンを再生パワー 1.6 mW で再生したと きの再生波形である. この再生波形には前述のような重畳 信号は見られない.

また、Fig.7 にキャリア、ノイズ、および CNR の周波数 依存性を示す. この図で、周波数 3 MHz 以下の領域では、 キャリアレベルの周期的な変動が見られる. これは、対応 する磁区長 0.25  $\mu$ m 以上の領域で、ゴースト信号が発生し

日本応用磁気学会誌 Vol. 23, No. 2, 1999



**Fig. 7** Frequency dependencies of the carrier level, noise level, and CNR.



**Fig. 8** Domain length dependence of the dropout rate.

ていることを示している. ゴースト信号は, 媒体が結合切 断領域を通過するのに要する時間に対応した一定の遅延時 間をもって発生するので, 信号周波数に伴って同相で重畳 される場合と逆相で重畳される場合とが交互に現れ, キャ リアレベルの周期的な変動が起こるのである. 逆に, 磁区 長 0.25 μm 以下の領域では, キャリアレベルがフラットで あり, ゴースト信号が発生していないことを示している.

このように磁区長が短くなるとゴースト信号が発生しな くなる理由については後述する.

磁壁移動検出方式は、原理的に信号振幅が磁区長に依存 しない. Fig. 7 を見ると、磁区長 0.1 µm 以下になるとキャ リアが低下しはじめているが、これは Fig. 8 に示したよう に信号欠落が生じはじめることに起因したものであり、信 号振幅は 0.1 µm 以下に至っても一定である.

磁区長 0.1 µm 以下で信号欠落が生じる原因について は、磁気力顕微鏡による磁区観察の結果などから、記録状 態の不良に起因していることが確認されている.特にラン ド上のグルーブに近い部分において、前後の磁壁の端部同 士がつながってしまっている状態がしばしば観察される.

この部分は、グルーブをアニールしたときの影響で磁気特性がある程度劣化していると考えられるので、レーザーア ニール以外の手段でトラック間の分断を行えば、磁区長 0.1 µm 以下でも信号欠落はかなりのレベルまで抑制でき



Fig. 9 Rear process of the DWDD.

ると考えている.

#### 3.2 ゴースト信号の抑制

Fig. 9 を用いてゴースト信号発生のメカニズムについて 少し詳しく説明する.

Fig. 9(a) のように、メモリ層中の磁区前端部が結合切断 領域後方の再結合領域に侵入すると、移動層とメモリ層と のスピン配向が反平行であるので、磁壁(1)と温度  $T_s$ の位 置  $X_2$  との間のスィッチング層内に界面磁壁(2)が形成さ れる. 媒体の走査に伴って、この界面磁壁は、より低温の 界面磁壁エネルギー密度の高い領域に広がっていき、エネ ルギーが蓄積されていく.

移動層の核形成をひき起こすのに十分なエネルギーが蓄 積される位置  $X_N$  まで界面磁壁が広がると, Fig. 9(b) のよ うに,移動層の一部が磁化反転して磁壁 (3) および (4) が 形成される.磁壁 (4) は温度勾配による磁壁駆動力によっ て直ちに再生スポット内のピーク温度近傍まで磁壁移動し ていき,ゴースト信号を発生させるのである.

ここで、磁壁 (4) には、温度勾配による力 $F_g$  のほかに、 メモリ層との交換結合による力 $F_i$ が作用する、 $F_i$ は界面 磁壁の形成されている領域を縮小させる方向に作用する. したがって、Fig. 9(b) では磁壁 (4) を右側方向に移動させ る方向に作用する.

ところが, Fig. 9(c) に示したように, 磁区長が短く, 磁 壁 (4) が形成された時点で, メモリ層中の磁区後端部の磁 壁 (5) が, すでに再結合領域に侵入してきている場合には, 磁壁 (4) がメモリ層中の磁壁 (5) の位置まで磁壁移動する と界面磁壁は消滅する. 磁壁 (4) がさらに右側に磁壁移動 すると逆に新たに界面磁壁を形成することになるので力  $F_i$ は左側方向に作用することになる. 結合切断領域のご く近傍以外では,交換結合による力 $F_i$ は,温度勾配による カ $F_g$ よりもはるかに大きいので,磁壁 (4) は磁壁 (5) の位 置よりも右側には磁壁移動できず.ゴースト信号が発生し なくなるのである.

そこで、このような短い磁区だけで信号を構成すれば、 ゴーストのない再生信号を得ることができる。前述の実験 結果より、Fig. 4 の構成のサンプルでは、マーク長 0.25 µm 以下のマークのみで信号を構成すればよいことにな る。しかし、信号欠落の観点から最短マーク長に制限があ ることと、検出窓のマージンを考慮すると、どのような変 調方式を使用するにしても、もう少し長いマーク長まで ゴーストが発生しないように改良しないと、マークエッジ 記録による実用性のある高密度記録は困難と考えられる。

ゴーストが発生しない磁区長を長くするためには,温度 分布の工夫なども有効であるが,媒体側の工夫のみで対処 するには,移動層内での核形成の発生を遅らせるように磁 気特性を調整すればよい.すなわち,核形成に必要なエネ ルギーを増大させるか,界面磁壁が相当温度低温側に広が るまで核形成に十分なエネルギーが蓄積されないようにす ればよい.しかし,そのために不用意に移動層の異方性を 増大させたり,界面磁壁エネルギー密度を低下させたりす ると,転写性が低下して再生特性が劣化してしまう.

そこで,移動層とスィッチング層との間に,磁壁エネル ギー密度が移動層よりも大きく,キュリー温度がスィッチ ング層よりも高い磁性層を挿入することにした<sup>71</sup>.これに より,核形成に必要なエネルギーが増大する一方で,低温 領域では界面磁壁エネルギー密度が増大するので転写性を 維持できる.

この結果,この改良媒体においては,再生特性が劣化することなく磁区長 0.8 µm 程度までゴーストが発生しなくなった.

この改良媒体に,最長マーク長に制限のある変調方式として (1,7)RLL 変調方式を用いて,線記録密度 0.1 µm/bit のランダム信号を記録した.このときのアイパターンを Fig. 10(b) に示す. Fig. 10(a) は,同じ信号を改良前の媒体 に記録したときのアイパターンである.この信号の場合,

最短マーク 2 T は  $0.133 \mu m$  であり,最長マーク 8 T は  $0.533 \mu m$  になる. したがって,改良前の媒体では 4 T 以上のマークでゴーストが発生してしまうが,改良媒体では この信号に含まれるすべてのマークでゴーストが発生しない. この結果, Fig. 10(b) のように良好なアイパターンが 得られている.

Fig. 11 に,改良媒体に (1,7)RLL 変調方式でランダム信 号を記録したときのジッターの線記録密度依存性を示す. ジッター値 18% 以下を実使用可能レベルとすると,再生



A2 -0,060 V 3 44.4.4.5 44.4.5 100mV 50ns (b)





**Fig. 11** Linear density dependencies of the jitter for various readout conditions.

パワーに±15% の変動を見込んでも、 $0.1 \,\mu$ m/bit 程度の 高密度記録が十分に可能である。測定したジッターは data-to-data jitter であるので、このジッター値 18% は、 data-to-clock jitter に換算すると約 13% に相当し、ジッ ター分布をガウシアンと仮定した場合、約 1×10<sup>4</sup> のビッ ト・エラー・レートに相当する.

なお、本稿では説明を省くが、再生磁界を印加することで、マーク長に関わらずゴースト信号を抑止することも可能である<sup>6</sup>.

日本応用磁気学会誌 Vol. 23, No. 2, 1999

### 4. 狭トラックピッチ化

これまで、トラックピッチは 1.1 µm で検討を行ってき ている.しかし、面記録密度の向上のためには、狭トラッ クピッチ化を合わせて行うことが重要である.狭トラック ピッチ化にはランド/グルーブ記録を行うことが有効であ るが、その場合、グルーブ部をアニール処理している現状 の実験手法は適用できない.また、生産性の観点からも別 の手法を確立することが望まれる.

この課題に対して, Fig. 12 に示したように, 急峻なテー パー部を有する Deep Groove 基板<sup>8)</sup>を用いて対応すること を検討中である. この基板に指向性の高い成膜方法で記録 膜を成膜することにより, テーパー部には実質的に記録膜 が堆積しないようにする. このようにすることにより, ラ ンドとグルーブそれぞれに, 側部の磁壁が実質的に存在し ない磁区を形成することが可能になり, グルーブ部をア ニール処理したときと同等の効果が得られると考えてい る.

現状はまだ検討に着手した段階であり,成膜プロセスの 最適化などが不十分なため,報告に足るような信号特性は 得られていないが,この方法で磁壁移動検出方式の基本動 作が可能なことは,現在までの検討で確認できている.

テーパー部に記録膜が堆積しないようにすることは、隣 接トラックへの熱干渉を抑制する上でも有効である.この ことは、Deep Groove 効果と合わせて、クロスイレーズ耐 性の向上につながるばかりでなく、磁壁移動検出方式に とってはクロストークの抑制につながる.なぜなら、再生 時に隣接トラックを磁壁移動開始温度 T<sub>s</sub>以上に加熱しな いようにできるからである.このため、隣接トラックの信 号は通常再生方式により再生されることになるが、記録さ れている信号が通常再生方式では再生できないような高密 度記録信号であることを前提としているので、大きなクロ ストークは発生しないことになる.また、磁壁移動検出方 式の信号は立ち上がりが急峻なので、クロストークがジッ



Buffer zone (no magnetic layer or extremely thin layer) Fig. 12 Land/groove recording with DWDD. ターに及ぼす影響は通常再生方式に比べて格段に小さいと 考えられる.

## 5. ま と め

以上,温度勾配による磁壁移動現象を利用した新規な光 磁気再生方式について,通常の光磁気ディスクドライブを 用いて実動作が確認されたことを報告した.

動作確認の結果,光学系の分解能をはるかに超えた磁区 長 0.1 µm の連続パターンにおいても良好な再生波形が観 察され,磁区長に依存せず一定の信号振幅が得られること が確認された.磁区長が長い場合には後方からの磁壁移動 による重畳信号が観察されたが,媒体構成を改良すること により,磁区長が 0.8 µm 程度以下の場合には重畳のない 信号が得られるようになった.

改良媒体に (1,7)RLL 符号で記録することにより, 線記 録密度 0.1  $\mu$ m/bit においても実用上十分なジッターマー ジンが得られることを確認した.

狭トラックピッチ化のために、本方式にランド/グルー ブ記録を適用する道筋を示し、クロストークの観点から本 方式が狭トラック化にも適していることを説明した.

ランド/グルーブ記録を行えば、現行の光学系でも 0.6  $\mu$ m/track 以上の狭トラック化が十分可能であり、その場 合、磁壁移動検出方式により面記録密度 10 Gbits/inch<sup>2</sup> 以上、DVD サイズ片面 15 GB 以上の書換え型光ディスク が、現行の光学系に何ら変更を加えることなく実現される ことになる.

## 文 献

- K. Aratani, A. Fukumoto, M. Ohta, M. Kaneko, and K. Watanabe: Proc. SPIE, 1499, 209 (1991).
- Y. Murakami, N. Iketani, J. Nakajima, A. Takahashi, K. Ohta, and T. Ishikawa: J. Magn. Soc. Jpn., 17(Suppl. No. 1), 201 (1993).
- H. Awano, S. Ohnuki, H. Shirai, N. Ohta, A. Yamaguchi, S. Sumi, and K. Torazawa: *Appl. Phys. Lett.*, 69(27), 4257 (1996).
- T. Shiratori, E. Fujii, Y. Miyaoka, and Y. Hozumi: J. Magn. Soc. Jpn., 22(Suppl. No. S2), 47 (1998).
- 5) B. G. Huth: IBM J. Res. Develop., 18, 100 (1974).
- T. Shiratori, E. Fujii, Y. Miyaoka, and Y. Hozumi: ISOM '98 Technical Digest, Tu-F-02, p. 46 (1998).
- T. Shiratori, E. Fujii, Y. Miyaoka, and Y. Hozumi: MO-RIS '99 Technical Digest, to be published.
- S. Morita, M. Nishiyama, and T. Ueda: Jpn. J. Appl. Phys., 36(Part 1, No. 1B), 444 (1997).

(1998 年 11 月 19 日受理)



白鳥 力 しらとり つとむ 昭59 千葉大学理学部物理学科卒業,同 年 キャノン(株)入社,現在に至る. 専門 光磁気記録